

AWC[®] UF-429

Limpiador con Cloro de alto pH
para Membranas UF/MF

VENTAJAS

- Formulación en polvo que contiene cloro, dispersantes, y otros compuestos de limpieza diseñada específicamente para remover ensuciamiento orgánico de la superficie y poros de membranas MF/UF
- Penetra y remueve fuerte suciedad orgánicas y el limo biológico
- Dispersa las partículas inorgánicas tales como limo, sílice, arcilla y otras partículas coloidales
- Disuelve hidróxidos metálicos de coagulantes
- Bufferado para mantener un rango de pH estable incluso cuando ocurre una sobredosis accidental
- Compatible con la mayoría de módulos de microfiltración y ultrafiltración tolerantes a cloro
- Certificado por NSF bajo la norma NSF/ANSI 60

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Polvo blanco granular
Olor	Leve olor a cloro
Solubilidad en Agua	Soluble
pH (solución al 1%)	10 - 11
Contenido de Cloro (solución al 1%)	500 ppm cloro disponible

EMPAQUE

Contenedores plásticos de 50 libras o 400 libras

SEGURIDAD Y MANEJO

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga los contenedores cerrados. Lave las ropas contaminadas antes de re-utilizar. Para mayor información, por favor ver la hoja de seguridad (HDS) suministrada con el producto.

ALIMENTACIÓN QUÍMICA Y CONTROL

La solución limpiadora debe ser preparada usando filtrado MF/UF. Para mejores resultados evitar usar agua de alta dureza. Preparar la solución usando 9 - 17 lb. de AWC UF-429 por cada 100 galones de agua (Solución al ~1-2 wt%). Para alto ensuciamiento, se recomienda un tiempo mínimo de limpieza de 3 horas. Calentar la solución a la temperatura máxima permitida por el fabricante del módulo, mejorará los resultados de limpieza.

Procedimientos de limpieza es como sigue:

- Circular la solución de limpieza a través de los módulos con la válvula del filtrado cerrada, en la dirección de alimentación por 30 minutos (para diseños tubulares).
- Alternar con remojo por 30 minutos.
- Reversar la dirección del flujo y recircular por 30 minutos más.
- Repetir pasos 1 - 3.

Si el pH disminuye por debajo del rango objetivo de 10 - 11, adicione más AWC UF-429 para mantenerlo en el rango durante todo el proceso de limpieza. No exceda el tiempo de exposición a limpiadores de alto pH recomendadas por el fabricante de membranas y no exceda la tolerancia a peróxido de hidrógeno de la membrana. Si el retro-lavado es permitido por el fabricante, los resultados de la limpieza pueden ser mejoradas por un retro-lavado de la solución desde el lado de filtrado a lado de alimentación por 15 minutos. Después de terminar la limpieza, los módulos deben ser enjuagados con filtrado MF/UF.

